

応用物理学会関西支部 2025年度第1回講演会のご案内

-AI時代の材料・プロセス開発からエッジデバイス開発まで-



応用物理学会関西支部
支部長 裏 升吾

応用物理学会関西支部講演会では、毎回特定のテーマを取り上げ、第一線でご活躍されている研究者・エンジニアに研究開発の現状をご紹介いただくとともに、学生を中心とした若手の発表の場も設け、研究成果の発信を通して相互の交流を深めることを目的としております。2025年度第1回講演会は、「AI時代の材料・プロセス開発からエッジデバイス開発まで」を招待講演のテーマとし、国内外で開発競争が活発な AI 半導体を搭載したマイコン開発と、その製造に必要不可欠となる半導体デバイスプロセス・材料作製技術に関する、データ駆動型アプローチに基づく研究との最新状況をご講演いただきます。また、大学研究者、企業研究者、学生間の交流を図ることを目的として、応用物理学全般に関するポスター発表、並びに、講師または賛助会員企業様と学生が気軽に懇談できる「Meetup」を開催いたします。

- 【主催】公益社団法人 応用物理学会 関西支部
【日時】2025年6月3日(火) 13:00 開始
【場所】産業技術総合研究所 関西センター C-4 棟 第8会議室 (阪急池田駅より徒歩約20分)
<https://www.aist.go.jp/kansai/ja/access/index.html>



会場アクセス

【内容】

第一部：講演の部「AI時代の材料・プロセス開発からエッジデバイス開発まで」

- 13:00～13:05 開会の辞
- 13:05～13:40 招待講演「自律材料探索」
岩崎 悠真 (物質・材料研究機構)
- 13:40～14:15 招待講演「機械学習制御による結晶成長プロセスの操業自動化」
原田 俊太 (名古屋大学)
- 休憩 ----
- 14:30～15:05 招待講演「先端半導体製造用プラズマプロセスにおけるデータ駆動科学の活用」
浜口 智志 (大阪大学)
- 15:05～15:40 招待講演「不揮発性メモリ ReRAM とその CiM (Compute in Memory) 応用」
粟村 聡資 (Nuvoton Technology)
- 休憩・ポスター発表準備 ----

第二部：ポスター発表「最新の研究」・Meetup の部

- 16:00～18:00 ポスター発表および Meetup (同時並行開催)
- ★ 応用物理学に関する内容であれば分野は限定いたしません。奮ってお申込み下さい。
 - ★ ポスター発表要旨 (日本語の場合 200 字程度, 英語の場合 150words 程度) をご提出いただきます。
 - ★ 優秀なポスター発表には賞を授与します。(受賞対象者: 2026年4月1日時点で満33才以下)
ポスター賞の詳細 (受賞者名・受賞タイトル名, 受賞コメントなど) は、支部 HP に掲載予定です。
 - ★ ポスター発表される学生にはトラベルサポートもあります (旅費支援を申請される方のみ)。
- 18:00～18:05 閉会の辞
18:05～ 懇親会・ポスター賞授賞式

- 【定員】100名 (申込順)
【参加費】無料 (懇親会参加の場合、懇親会費 2,000 円 (予定) を頂きます。学生の懇親会費は無料です。)
【申込】**ポスター発表申込:** Web サイト (<https://jsap-kansai.jp/>) より予稿テンプレートをダウンロードの上、必要事項を記入して、メール添付にて下記申込先までお送りください。
聴講申込: 上記 Web サイトの聴講申込フォームからお申し込み下さい。
- 【申込先】応用物理学会関西支部事務局
〒565-0871 吹田市山田丘 2-1 大阪大学大学院工学研究科物理学系専攻内
TEL / Fax : 06-4864-0125 (火, 金曜日のみ), e-mail : secretary@jsap-kansai.jp

【申込締切】5月19日(月) 正午

- 【問合せ先】山田 英明 (産業技術総合研究所) yamada-diamond@aist.go.jp
姫野 敦史 (パナソニックホールディングス株式会社) himeno.atsushi@jp.panasonic.com
近藤 裕佑 (大阪産業技術研究所) kondoy@orist.jp
田中 一 (関西学院大学) tanaka.hajime@kwansei.ac.jp